

Proje Yarışması

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu'nun düzenlediği Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda, bu yıl Kimya dalında birinciliği iki proje aldı. Bu sayıda sizlere, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel İşık Lisesi öğrencilerinden Burak Karacık ve Burak Tutkuner'in yaptıkları "Sol-Gel Metodu ile $\text{SiO}_2\text{-}\text{ZrO}_2$ Oksit Filmelerin Hazırlanması" başlıklı çalışmayı tanıtıyoruz.

Sol-Gel Metodu ile $\text{SiO}_2\text{-}\text{ZrO}_2$ oksit Filmelerin Hazırlanması

Günlük yaşamımızda, çevremizde bulunan, sıkılıkla kullandığımız birçok eşyanın yüzeyi ile ana yapının farklı olduğunu pek düşünmemeyiz. Bulduğumuz odanın duvarları boyalı ya da kağıt gibi herhangi bir maddé ile kaplanmıştır. Kullandığımız masa ve benzeri ahşap eşyalar da boyanmış ya da verniklenmiştir. Çevremizde boyanmamış demir eşya yok gibidir. Bütün eşyaları bu halleriyle görmeye alıştığımız için çoğu zaman bu kaplamaların sadece dekoratif amaçlı olduğunu düşünür, hatta eşyaları bu halleri ile algıladığımızdan yüzeylerinin değişik bir madde ile kaplı olduğunu fark etmeyiz.

Aşında bu eşyaların yüzeyleri sadece dekoratif amaçla değil, gerek temizlemeleri gerekse kullanımları sırasında dış etkenlerden korunması amacıyla kaplanmıştır. Çokluğulukla, eşyanın ana maddesi ile yüzeyini kaplayan madde tamamen farklı malzemeden yapılmışlardır. Kaplanmayan eşyalar, kötü görünüşlü ve dış etkenlere karşı dayanıklısı olacakır. Ancak bazı durumlarda yüzeyin kaplanması kaçınılmazdır. Elektrik teliерinin, elektriğe geçirilmeyen bir maddé ile kaplanmadan kullanılması düşünülemez. Yüzeylerin kaplanması, malzemelerin özelliklerini iyileştirmek amacıyla da yapılır. Örneğin, otomobillerde kullanılan aynalardan bazlarının ışığı fazla miktarda yansıtıp gözümüzü rahatsız ettiğini, bazlarında ışığı peki yansıtmayarak rahat bir görüş sağladığını görebiliriz. İşte bu, aynaya kaplanmış ince bir filmin, ışığın yansımamasına neden olan yüzeyinin özelliklerini değiştirmesindenilen gelmektedir. Aynalarada sağlanan bu iyileşme, ayna-cam fırızındaki cam bir kaplamadan, farklı yapısı nedeniyle, sahip olduğu bazı fiziksel özelliklerinin bir sonucudur.



İşte, Burak Karacık ve Burak Tutkuner'in Sol-Gel Metodu ile bir plaka üzerinde hazırladıkları farklı miktarlarda $\text{SiO}_2\text{-}\text{ZrO}_2$ içeren gel filmi de, bileşimi özellikleri nedeniyle, bazı malzemelerin yüzeyine kaplanarak çeşitli alanlarda kullanılabiliriyor. Örneğin, güneş enerjisinden yaranmak amacıyla hazırlanan hücrelerin yüzeyi, üzerine gelen ışığı ne kadar az yansıtırsa o kadar çok verim elde edilir. Belirli bileşimlerde hazırlanan film eger böyle bir yüzeye bir veya birkaç kat kaplanırsa hücrenin verimini artırır. Silisyum dioksit ve zirkonyum dioksitten oluşan film, bu amaçla kullanılabilir gibi, bazı kimyasal maddelerle karşı da dayanıklı olduğundan, bu tür maddelerden etkilenmemesi amacıyla metallerin yüzeylerine kaplanabiliyor. Kaplama işlemlerinde, özellikle oksit yapıları olan bu tipte filmlerin oluşturulmasında, filmin yapısı kadar yüzeye kaplanması çok önemli. Özelliklerini koruması açısından diğer önemli bir nokta da, kaplama sırasında filmin kalınlığının kontrol edilmesi, yapının her noktada aynı kalması. Kullanılan maddelerin ucuz olması da uygulama açısından avantaj sağlayarak, bu alandaki çatış-

malara yeni ve olumlu katkılar getireceğe benzeyor.

Çeşitli malzemelerin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi veya yüzeye yeni özellikler kazandırılması amacıyla bu malzemelerin organik veya inorganik maddelerle kaplanması yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Özellikle kütlesel yapılardan çok, yüzey özelliklerinin önem kazandığı durumlarda, kaplama yöntemi birçok yönden avantajlı olabiliyor. Yeni bir yüzey oluşturmak için, diğer birçok fiziksel ve kimyasal yöntemden yanında, özellikle oksit filmelerin hazırlanmasında Sol-Gel metodu yaygın olarak araştırılmış uygulanıyor. Sol-Gel metodu ile metal oksitlerin eldesinde en yaygın olarak kullanılan başlangıç maddeleri ise metal alkoksider. Bunlar kolayca saf elde edilebilir, organik çözümlerde çözünebilir, hidrolizle metal hidroksitlerle ve takip eden hatta birlikte yürüyen kondensasyon reaksiyonu ile kolayca once gel hale sonda da oksite dönüştürülür. Metallerin anorganik bileşikleri kullanılsa da, bunların genellikle organik çözümlerde sınırlı çözünürlükleri, sulu ortamlarda ise kristalleşme eğilimleri, kullanımını belirli ölçülerde sınırlıyor. Ancak yine

de bu bileşiklerin kullanılması, gerekli önlemlerin alınması ile mümkün.

İki veya daha fazla metal alkoksit kullanılmış durumunda bazen alkoksitlerden bir veya birkaçıının bir ön hidrolize tabii tutulması gerekebiliyor. Bu reaksiyon sonucunda oluşan hidroksil gruplarının kondensasyonu ile M-O-M (metal-oksijen-metal) bağlantı oluşur. Ancak reaksiyonlar sonucunda bir çokelti değil, gelişmiş bir şebekе yapısının olması gereklidir. Bunun yanı sıra, kondensasyon reaksiyonlarının sonunda elde edilen gelişmiş yapıda, reaksiyona girmeden kalmış olan gruplar her zaman mevcut ve bu grupların eliminasyonu ile tamamıyla oksitlere dönüştürülmenin bir işi işlem gereklidir. Bu işi işlemde sıcaklık genellikle 500 °C civarında veya altındadır. Bu da Sol-Gel metod ile oksitlerin eldesinin, klasik yöntemlere oranla, diğer bazı avantajlarının yanı sıra, yüksek sıcaklıklara yakma gerekliliğini ortadan kaldırması yönünde ek bir avantajını da ortaya koymaktır.

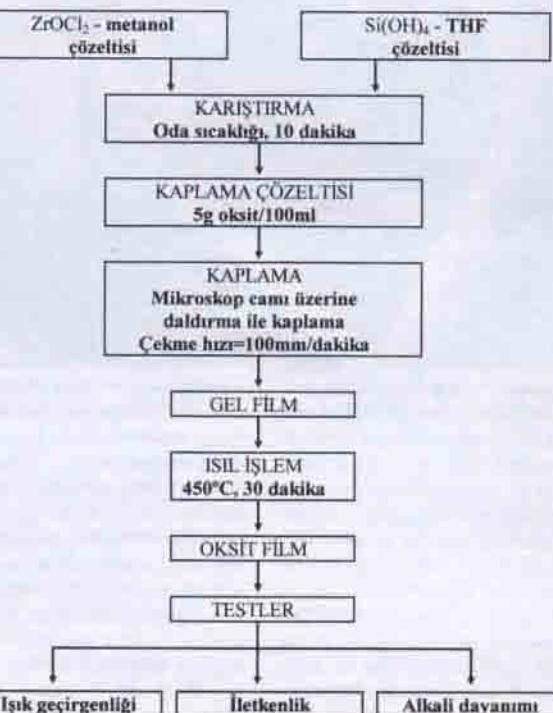
$\text{SiO}_2\text{-}\text{ZrO}_2$ oksit sistemiyle ilgili çalışmaların başında başlangıç maddeleri olarak her iki metalin de alkoksitleri kullanılmıştır. İşlemde, kohidrolyz ve kondensasyon ile önce gel olusarak işi oksite dönüştürülür. Hazırlanan bu ikili sistemde, ZrO_2 içeriğine bağlı karışımın kırılma indisi değişiyor ve ZrO_2 oranı arttıkça daha yüksek kırılma indisine sahip ürünler elde ediliyor. Bu oksit sisteminin bir diğer önemli özelliği de alkaliye karşı dayanıklı olması; ZrO_2 oranı arttıkça alkali dayanımı belirgin ölçüde artıyor.

Bu ikili sistemin elde edilmesinde az da olsa silisyum tetraalkoksit ile birlikte zirkonyumun inorganik tuzlarını da kullanılıyor. Örneğin, bir çalışmada $\text{Zr}(\text{NO}_3)_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kullanılarak, yine alkaliye karşı dayanıklı film oluşturmak amacıyla $\text{SiO}_2\text{-}\text{ZrO}_2$ oksit sistemi hazırlanmış.

Oksitlerin elde edilmesinde kullanılan alkoksit bileşiklerinin nispeten pahalı olması ve daha da önemlisi hidroliz ve kondensasyon tepkimeyi sırasında geçer olan bu alkoksitlerdeki buharlaşmalar nedeniyle ilk karışımın bileşimi ile gel veya oksit bileşiminin farklılık göstermesi alkoksitlerin kullanılmasında ilk akla gelen problemler. Ancak, Sol-Gel metodunda, bu metallerin organik çözümlerde çözünebilir anorganik bileşikleri kullanırsı, hem maliyet açısından hem de



AKIŞ ŞEMASI



Tablo 1: Kaplama çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan çözelti miktarları ve bileşimleri

Deney No.	Kaplama Çözeltisi	Silisik Asit (ml)	ZrOCl ₂ .8H ₂ O (ml)	SiO ₂ / ZrO ₂ (mol)
1	Zr0	50	-	10/0
2	Zr1	40	9.10	9/1
3	Zr2	40	20.50	8/2
4	Zr3	30	26.35	7/3
5	Zr4	20	27.33	6/4
6	Zr5	20	40.98	5/5
7	Zr6	15	46.11	4/6
8	Zr7	10	47.82	3/7
9	Zr8	5	40.98	2/8
10	Zr9	5	92.22	1/9
11	Zr10	-	50.00	0/10

Tablo 2: Elde edilen oksit filmlerin % ışık geçirgenlikleri ve alkali dayanımları

Deney No.	Kaplama Çözeltisi	İşik Geçirgenliği (%)	Oda Sıcaklığında Alkali Dayanımı		80°C'de Alkali Dayanımı	
			1N	5N	1N	5N
1	Zr0	93.1	*	*	*	*
2	Zr1	-	*	*	*	*
3	Zr2	-	*	*	*	*
4	Zr3	85.7	*	*	*	*
5	Zr4	-	*	*	*	*
6	Zr5	79.3	*	*	*	*
7	Zr6	-	*	*	*	*
8	Zr7	78.1	*	*	*	*
9	Zr8	-	*	*	*	*
10	Zr9	73.7	*	*	*	*
11	Zr10	-	*	*	*	*

- Ölçümler yapılmadı.

* Filmlerde gözle tespit edilebilir herhangi bir bozulma yoktur.

bileşimin işlem boyunca değişmeden kalabilmesi açısından belirli bir üstünlük sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra alkoksit yönteminde görülebildiği gibi reaksiyona girmeden kalabilecek organik grupların uzaklaştırılması gerekliliği ile karbonize olmuş safızlıklar kalması riski de ortadan kaldırılmış olacak. Ayrıca, özellikle oksit film oluşumu sırasında büyük hacimli organik grupların ılışla uzaklaştırılmasıyla olusabilecek boşluklar minimum boyutu indirgenmiş olacak ve böylece daha düşük sıcaklıklarda daha yoğun filmler elde edilebilecek.

Burak Karacık ve Burak Tutkuner bu çalışmalarında SiO₂ kaynağı olarak sodyum metasilikatın HCl ile reaksiyon ürününden tetrahidrofuran ile ekstraksiyonla elde edilmiş ve konsantrasyonu 5g SiO₂/100 ml olacak şekilde seyrelmiş olan silisik asit (Si(OH)₄) ZrO₂ kaynağı olarak ise metanolde çözüldükten sonra ZrOCl₂.8H₂O mol orani 4 olacak şe-

kilde asetik asit (CH₃COOH) ilave edilerek hazırlanan zirkonyum oksiklorür (ZrOCl₂.8H₂O) kullanılmıştır.

Silisik asit zirkonyum oksiklorür arasında beklenen tepkime sembolik olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir: nZrOCl₂ + nSi(OH)₄ → Cl-(Zr-O-Si)-OH + (n-1) HCl

Zirkonyum oksiklorür çözeltisi hazırlamırken, asetik asit, zirkonyum bilesigini, kristal suyu nedemle çözelti içerisinde önceden hidrolizlenerek kendi arasında çokelti oluşturmasını engellemek amacıyla, hidroliz sonucu oluşan -OH gruplarının kısmen de olsa bloke edebilmek için ilave edilmiştir. Bu aynı zamanda silisik asitte olabilecek hızlı bir reaksiyonu da engelleyerek homojen bir çözelti oluşumunu da katkıda bulunmuştur.

Kaplama kullanılacak çözeltiler, kullanmadan hemen önce çeşitli SiO₂/ZrO₂ mol oranlarını sağlayacak şekilde hesaplanmış miktarlarda sil-

ik asit çözeltisinin yine hesaplanmış miktarındaki zirkonyum oksiklorür çözeltisi üzerine ilavesi ve laboratuvar şartlarında 10 dakika karıştırılarak hazırlanmış. Her iki başlangıç çözeltisinin de derisi metal oksit einsinden 5g/100ml olması nedeniyle tüm kaplama çözeltilerinin derisi sabit ve 5g metal oksit/100 ml. Laboratuvar koşullarında 76x26 mm boyutlarındaki mikroskop camlarının çözelti içerisinde daldırılmış sabit hızda hareket eden bir sistem yardımıyla 100 mm/dakika hızla yukarı doğru 90°'lık bir açıyla çekilerek kaplamalar hazırlanmış. Kaplanmış cam plakalar laboratuvar şartlarında 5 dakika bekletildikten sonra 450 °C sabit sıcaklığı istenmiş bir fırın içersine 30 dakika süre ile konularak ılış işlemeye tabi tutulmuş ve kaplama sonrası oluşan film, oksit film haline dönüştürülmüş. Oksit filmlerin ışık geçirgenlikleri ise bir spektrofotometre yardımıyla ölçülmüş. Alkali dayanım test-

leri, kaplanmış plakalar 1N ve 5N NaOH çözeltilerinde laboratuvar koşullarında 48 saat ve 80 °C'de 4 saat bekletilerek yapılmış. Testlerde ilgili sonuçlar Tablo 2'de görülmüştür.

Bütün bu işlemler sonucunda hazırlanan kaplama çözeltilen tamamen homojen bir yapıya sahip. Sol-Gel metodunda, özellikle inorganik başlangıç maddeleri ile çalışıldığında karşılaşılan homojen çözeltilerin elde edilememesi, yanı herhangi bir çözme veya kristallanma, hem çözeltide hem de film oluşumu sonrasında gözlenmemiştir. Homojen olarak elde edilen bu çözeltilerden oluşturulan gel filmler, ılış işlemesinden sonra yine homojen olan oksit filmlere dönüştürülmüş. Tablo 2'de görüldüğü gibi oksit filmle kaplanmış cam plakaların ışık geçirgenlikleri, cam plaka ile ZrO₂ örneğinin ışık geçirgenlikleri yaklaşık aynı olmasını taşımış, ZrO₂ oran arttıkça azalıyor. Bu ZrO₂ in SiO₂'ye oranla yüksek olan kırılma indisinden ileri geliyor.

ZrO₂ in kırılma indisine olan bu katkısı nedeniyile, bu tip kaplamaların bir veya çok katı ve farklı bileşimlerde uygulanması ile solar hücrelerde (Güneş enerjisini depolayan hücre) antireflektif film olarak kullanılması mümkün. Alkali dayanımları ile ilgili testlerde ZrO₂ içeren bu filmlerin, alkaliye belirtilen şartlarda dayandığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, özellikle başlangıç maddeleri göz önüne alınıldığından, bu yöntemin, SiO₂-ZrO₂ oksit filmlerin hazırlanmasında bir alternatif sunduğu ve solar hücreler için kullanılan antireflektif filmlerin oluşumu için de yeni bir yöntem olarak kullanılmasının mümkün olduğu görülmüştür.

Deneysel Sırasında

Burak Karacık ve Burak Tutkuner'in bu çalışma ile elde ettikleri antireflektif filmler, ilerde, Güneş enerjisini ısı veya ışık enerjisini çeviren sistemlerde, asıl yağmurllara karşı aşınmayı önlemek için camlarda, paslanmayı engellemek amacıyla metalik yüzeylerde, reaktifler sakınması ve depolanması için reaktörlerde ve çeşitli bilgisayar devrelerinde kullanılabilen bir malzeme olarak karşımıza çıkacak gibi görüneniyor.

Burak Karacık ve Burak Tutkuner'in hazırladıkları bu proje, TÜBİTAK'ın Proje Yarışmasında kimya dalında alıcı birincilik ödülünün dışında, daha önce de özel bir dersmenin açtığı proje yarışmasında da sergilenmeye değer bulunmuştur.



J. Burak Karacık,
03.06.1979'da Kırıkkale'de doğdu. İlk öğrenimini Kırıkkale Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Anadolu Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü. 11. sınıfında öğrencilerin en iyisi olarak devam eden Burak Karacık, liseyi mühendislik bölümünde bitirdi.



Burak Tutkuner,
08.02.1980'da Izmir'de doğdu. İlk öğrenimini FMV Özel İkinci Lise'de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Anadolu Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü. 11. sınıfında öğrencilerin en iyisi olarak devam eden Burak Tutkuner, liseyi mühendislik bölümünde bitirdi.